

会員限定

くまもと3D連携コンソーシアム

# 第2回産学連携交流セミナー

日時

令和7年2月18日(火)  
10:00~11:00

参加無料

<受付開始 9:45~>

会場

熊本大学 黒髪南地区・黒髪南W3(共用棟黒髪1)  
2階 物生講義室(203室)

申込み

下記フォームよりお申し込みください。  
<https://forms.gle/tstvcNYQ4KvUXE9i6>  
(2月17日(月)までにお申込みをお願いいたします。)

申込みQRコード



セミナー

## 「先端半導体形成用製膜プロセスと その場観察技術」



熊本大学  
半導体・デジタル研究教育機構 先端分野

### 百瀬 健 教授

半導体デバイスは性能向上、多機能化のため微細化、三次元化が進んでいます。デバイス形成の最重要技術の一つである製膜プロセスもこの構造変化に合わせていくつもの新規プロセスが導入されてきました。今後の更なる変化に対応するには複雑構造への均一製膜が可能な化学反応を利用した製膜プロセス「化学製膜」が必須です。

本セミナーでは、「化学気相成長法(CVD: Chemical Vapor Deposition)」「原子層堆積法(ALD: Atomic Layer Deposition)」「超臨界流体薄膜堆積法(SCFD: Supercritical Fluid Deposition)」を概説します。また、目まぐるしい社会変化に応じた迅速なプロセス構築のためには、製膜速度、膜厚、表面粗さ、膜組成、不純物濃度等を製膜中に評価する「その場観察技術」の活用が重要となるため、製膜プロセス用その場観察技術についても概説します。新たなその場観察技術の創出には、諸般の事情で使用されず眠っている技術の活用や半導体以外の分野で培われた技術の転用も重要であり、各社がお持ちの分析技術を再考するきっかけにもなれば幸いです。

◆お問合せ◆ くまもと3D連携コンソーシアム事務局  
熊本大学 熊本創生推進機構 イノベーション推進部門  
TEL: 096-342-3260 | E-Mail: kumamoto3d@ku-kico.org

